DERWENT-ACC-NO: 2000-437887

DERWENT-WEEK: 200038

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

F

Lead for electronic components such as semiconductor

device outer lead, has tin or tin alloy internal plating layer and silver external plating layer formed over lead

base material made of copper alloy wire

PATENT-ASSIGNEE: HITACHI CABLE LTD[HITD]

PRIORITY-DATA: 1998JP-0329714 (November 19, 1998)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC JP 2000156450 A June 6, 2000 N/A 004 H01L 023/50

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE
JP2000156450A N/A 1998JP-0329714 November 19, 1998

INT-CL (IPC): C25D005/10, C25D007/00, C25D007/06, H01L023/50

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000156450A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The lead that consists of a lead base material (1) made of **copper alloy wire**, has an internal **plating** layer (2) and external **plating** layer (3). The internal **plating** layer composed of **tin or tin alloy such as tin**-bismuth, **tin-antimony or tin**-indium **alloy**, is coated over the lead base material and the external **plating** layer composed of silver is coated over the internal **plating** layer.

USE - For electronic components such as electronic machine wiring and semiconductor devices.

ADVANTAGE - The lead wire prevents generation of whiskers and suppresses color

change. Environmental contamination by tin-lead alloy present in lead wires of electronic devices, is prevented by using the new tin alloy leads. The new tin alloy plated lead wire has favorable good electrical characteristics.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows different layers of lead wire.

Lead base material 1

Internal plating layer 2

External plating layer 3

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/2

TITLE-TERMS: LEAD ELECTRONIC COMPONENT SEMICONDUCTOR DEVICE OUTER LEAD TIN TIN

ALLOY INTERNAL PLATE LAYER SILVER EXTERNAL PLATE LAYER FORMING LEAD BASE MATERIAL MADE COPPER ALLOY WIRE

DERWENT-CLASS: L03 M11 U11

CPI-CODES: L03-A01A; L04-C11; M11-B02; M11-B04;

EPI-CODES: U11-A08B; U11-D03B3;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2000-133066 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2000-327789

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-156450 (P2000-156450A)

(43)公開日 平成12年6月6日(2000.6.6)

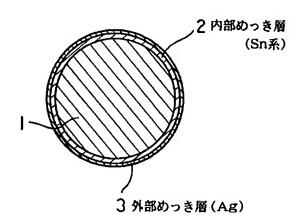
(51) Int.Cl.7		識別記号	F I 7- 73-}*(多考)
H01L 2	3/50		H01L 23/50 D 4K02	4
			V 5F06	7
C25D 5	5/10		C 2 5 D 5/10	
7	7/00		7/00 H	
7	7/06		7/06 U	
			審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 4	頁)
(21)出願番号	-	特顧平10-329714	(71) 出額人 000005120	
			日立電線株式会社	
(22)出願日		平成10年11月19日(1998.11.19)	東京都千代田区大手町一丁目6番1号	
			(72)発明者 秋野 久則	
			茨城県土浦市木田余町3550番地 日立	電線
			株式会社システムマテリアル研究所内	
			(72)発明者 珍田 聡	
			茨城県土浦市木田余町3550番地 日立	電線
			株式会社システムマテリアル研究所内	
			(74)代理人 100071526	
			弁理士 平田 忠雄	
			弁理士 平田 忠雄 最終頁(1

(54) 【発明の名称】 電子部品用リード

(57)【要約】

【課題】 これまで多用されてきたSn-Pb合金めっ きのリードと同等の性能を有しながら地下水を汚染せ ず、また、ウイスカーの発生および変色を抑えた電子部 品用リードを提供する。

【解決手段】 銅合金ワイヤー1の上に、Snあるいは Sn合金の内部めっき層2と、Agの外部めっき層3を 形成する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】リード母材と、前記リード母材の上に形成された内部めっき層と、前記内部めっき層の上に形成された外部めっき層から構成されるリードにおいて、前記内部めっき層をSnあるいはSn合金により構成

前記外部めっき層をAgにより構成したことを特徴とする電子部品用リード。

【請求項2】前記Sn合金は、Sn-Bi合金、Sn-Sb合金、Sn-In合金のいずれかであることを特徴 10 とする請求項第1項記載の電子部品用リード。

【請求項3】前記リード母材は、銅、あるいは銅合金等から構成されるワイヤーであることを特徴とする請求項第1項あるいは第2項記載の電子部品用リード。

【請求項4】前記リードは、伸線アニールとスキンバス 加工を施されたことを特徴とする請求項第1項ないし第 3項のいずれかに記載の電子部品用リード。

【請求項5】前記リード母材は、半導体装置のアウター リードであることを特徴とする請求項第1項ないし第3 項のいずれかに記載の電子部品用リード。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品用リード に関し、特に、電子機器配線用導体としてのリード、あ るいは半導体装置のアウターリードなどとして好適な電 子部品用リードに関する。

[0002]

【従来の技術】ダイオード、抵抗器、コンデンサ、あるいはトランジスタ等の電子部品に使用されるリードとして、たとえば、銅あるいは銅合金のワイヤー上にSn・ Pb合金、つまり、はんだめっきを施したものが知られている。

【0003】また、ICパッケージ等の半導体装置においては、接続対象のプリント基板との接続性を良好にするために、電解法、あるいは溶解法によりアウターリードの表面にはんだめっき層を形成することが行われている。

【0004】このような構成のリードは、熱酸化に対する優れた耐性と良好なはんだ濡れ性を備えていることによって特徴づけられ、電子機器の配線、あるいは電子品 40のプリント基板への実装等の用途において多用されており、この種リードによる接合プロセスは、高密度な接合技術を必要とする電子部品の分野においては完全に定着している。

【0005】しかし、このようなはんだめっき層を形成したリードによると、めっき層の中のPb成分が、酸性雨などによって溶出される性質のものであることから、地下水汚染、延いては人体への影響が懸念されており、このため、環境保護上の観点から、その使用に制約が加えられる傾向にある。

【0006】このため、Pbを含有しないPbフリーのはんだ合金の開発が各方面で進められており、その代表的な例として、Snめっき層を形成したリードを挙げることができる。このリードは、シンプルな材料系であり、Pbフリー合金との濡れ性もよく、強度的にも適している。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかし、Snめっき層を形成したリードによると、ウイスカーが発生しやすく、また、変色する傾向があり、Sn-Pb合金の代替めっきとしては特性的に充分とは言えない。

【0008】従って、本発明の目的は、これまで多用されてきたSn-Pb合金めっきのリードと同等の性能を有しながら地下水を汚染せず、また、ウイスカーの発生および変色を抑えた電子部品用リードを提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を達成するため、リード母材と、前記リード母材の上に形成された内部めっき層と、前記内部めっき層の上に形成された外部めっき層から構成されるリードにおいて、前記内部めっき層をSnあるいはSn合金により構成し、前記外部めっき層をAgにより構成したことを特徴とする電子部品用リードを提供するものである。

【0010】上記のリード母材としては、たとえば、対象が電子機器の配線に使用されるリードであれば、銅、あるいは銅合金等から構成されたワイヤーが使用される。リードフレームを使用した半導体装置のアウターリードが、本発明におけるリード母材を構成する用途は可能であり、また、リードフレームの代わりに銅箔の配線パターンと絶縁フィルムを積層したテープキャリアを使用し、これにより構成される半導体装置のアウターリードに本発明を適用することも可能である。

【0011】内部めっき層を構成するSn合金としては、Sn-Bi合金、Sn-Sb合金、Sb-In合金などが使用される。内部および外部に、Sn系のめっき層とAgのめっき層を形成した本発明の電子部品用リードは、伸線アニールとスキンパス加工(塑性流動を起こさせない加工)を施されることが好ましい。

【0012】外部めっき層を構成するAgには、伸線アニールとスキンパス加工を経ることによって、SnあるいはSn合金めっき層の中に拡散する性質があり、従って、これにより、リード母材の表面には、Sn-Ag合金、Sn-Bi-Ag合金、Sn-Sb-Ag合金、あるいはSn-In-Ag合金等のSn-Ag系めっき層が形成されることになる。

【0013】これらの合金めっき層は、リード母材への 密着性、はんだ濡れ性(はんだ付け性)、耐変色性、お よびウイスカー性において、特に良好な特性を示し、S 50 n-Pbめっきに劣らない特性を有することが確認され 3

た。

[0014]

【発明の実施の形態】次に、本発明による電子部品用リ ードの実施の形態について説明する。 図1は、本実施形 態における電子部品用リードの断面構造を示したもの で、1は外径0.6mmの銅合金ワイヤー、2は銅合金 ワイヤー1の上に形成された内部めっき層、3は内部め っき層2の上に形成された外部めっき層を示す。

[0015]

【実施例1】酸洗したワイヤー1の上に、厚さ6μmの 10 Snの内部めっき層2を電解法により形成し、次いで、 これに、同じく電解法により厚さO.05μmのAgの 外部めっき層3を形成し、所定の電子部品用リードを得 た。

【0016】内部めっき層2は、有機スルフォン酸系の めっき液を使用し、電流密度4A/dm² およびめっき 時間3分の条件のもとで成膜させ、一方、外部めっき層 3は、シアン系のめっき液を使用し、電流密度2A/d m²、めっき時間10秒の条件下で成膜させた。成膜 より、所定の電子部品用リードとした。

[0017]

【実施例2】実施例1において、内部めっき層2の構成 材をSn-Bi合金とした以外、他を同一条件とするこ とにより所定の電子部品用リードを得た。

[0018]

【実施例3】実施例1において、内部めっき層2の構成 材をSn-Sb合金とした以外、他を同一条件とするこ とにより所定の電子部品用リードを得た。

[0019]

【実施例4】実施例1において、内部めっき層2の構成 材をSn・In合金とした以外、他を同一条件とするこ とにより所定の電子部品用リードを得た。

[0020]

【従来例】図2において、銅合金ワイヤー1の上に厚さ 6μmのSn - Pb合金めっき層4を電解法により形成 し、所定の電子部品用リードを得た。

[0021]

【参考例】図2において、めっき層4を電解法による厚 さ6µmのSnめっきにより形成し、所定の電子部品用 40 電子部品の接合プロセスに定着してきたSn - Pb合金 リードを得た。

【0022】表1に、以上の実施例、従来例、および参 考例により得られた電子部品用リードの特性試験結果を 示す。試験項目としては、めっき層の密着性、はんだ渦 れ性、耐変色性、およびウイスカーの発生有無を選択し た。

【0023】めっき層の密着性は、水素雰囲気中におい てサンプルを350℃で15分間加熱し、引き続きこれ を大気中において250℃で2時間加熱した後、自己径 巻き付けを行ったときのめっき層の剥離の有無によって 50 評価した。

【0024】自己径巻き付けは、サンプルの一端をバイ スに挟み、他端を90°に曲げた状態で固定することに よりサンプルを所定の個所に張り、これに90°に曲げ た部分を支点としてサンプルを数10回巻き付けること によって行った。この試験で、めっき層に剥離が発生し ない場合を1、若干の剥離発生を2、完全な剥離発生を 3とした。

【0025】はんだ濡れ性は、MIL-STD-202 D-208Bの試験法に基づき、フラックスなしの状態 で密着性試験におけるのと同じ加熱処理を施したとき の、はんだ濡れ面積によって評価した。濡れ面積が90 %以上を1、70~90%未満を2、70%未満を3と した。

【0026】耐変色性は、40℃/95%RHの恒温恒 湿の雰囲気にサンプルを10日間放置したときの変色の 有無により評価し、変色なしを1、若干変色を2、変色 を3とした。

【0027】ウイスカーの発生有無は、121℃/60 後、これに伸線アニールとスキンパス工程を施すことに 20 %RHの恒温恒湿の雰囲気にサンプルを24時間放置し た後の目視判定によって確認した。発生なしを1、若干 発生を2、発生を3とした。

[0028]

【表1】

_		めっき層 の密着性	はんだ 高れ性	耐 変色性	ウイスカー 発生有無
実施例	1	1	. 1	1	1
	2	1	1	1	1
	3	1	1	1	1
	4	1	1	1	1
従来例		1	1	1	1
参1	\$ 6 91	1	1	1	3

【0029】表1によれば、実施例による電子部品用リ ードが、めっき層の密着性、はんだ濡れ性、耐変色性、 およびウイスカー発生有無のいずれにおいても従来例と 同じ1の評価を得ている。

【0030】これらの項目は、従来、長い間にわたって めっきリードの特性を評価するための試験項目であり、 従って、これらの試験項目において、Sn-Pb合金め っきリードと遜色のない試験結果を示していることは、 本発明によるリードが、Sn-Pb合金めっきリードに 代わる電子部品用リードとして、有効に活用可能なこと を意味している。Snめっき層を形成した参考例のリー ドの場合には、ウイスカー発生有無のテスト結果が悪 く、実用性において問題がある。

[0031]

【発明の効果】以上説明したように、本発明による電子

特開2000-156450

6

部品用リードによれば、リード母材の上にSnあるいはSn合金の内部めっき層と、Agの外部めっき層を順に形成したため、これまで多用されてきたSn・Pb合金めっきリードと同等の特性を有しながら地下水を汚染することもなく、また、ウイスカーの発生および変色の抑制によって信頼性を高めることができる。

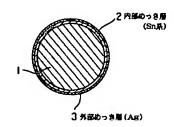
5

制によって信頼性を高める 【図面の簡単な説明】 【図1】本発明による電子部品用リードの実施の形態を 示す説明図。

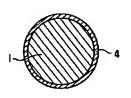
【図2】従来の電子部品用リードの説明図。 【符号の説明】

- 2 内部めっき層
- 3 外部めっき層

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 吉岡 修

茨城県土浦市木田余町3550番地 日立電線 株式会社システムマテリアル研究所内 F ターム(参考) 4K024 AA10 AA21 AB02 BA09 BB09 BB10 BC03 DA03 DB01 DB07 GA14 GA16 5F067 AA04 AA09 DC12 DC18 EA04